06;07 Частотноперестраиваемый безынверсный лазер дальнего инфракрасного и терагерцового диапазона на наногетероструктурах с квантовыми ямами

© В.А. Кукушкин

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород E-mail: vakuk@appl.sci-nnov.ru

Поступило в Редакцию 22 июля 2009 г.

Предложен и рассчитан вариант активной среды, способной обеспечить безынверсное частотноперестраиваемое усиление или генерацию электромагнитного излучения в дальнем инфракрасном и терагерцовом диапазоне. Он основан на сравнительно простой полупроводниковой наногетероструктуре с квантовыми ямами, которая способна работать при комнатной температуре (в импульсном режиме) и обеспечивать изменение рабочей частоты основанного на ней усилителя или генератора в несколько раз в результате изменения интенсивности накачивающего излучения. Такой усилитель или генератор (лазер) может стать удобным, дешевым и компактным перестраиваемым источником дальнего инфракрасного и терагерцового излучения для многочисленных технических, а также медицинских применений.

Усиление и генерация дальнего инфракрасного (ИК) и терагерцового (THz) излучения является важной задачей современной лазерной техники благодаря постоянно растущей сфере его использования в различных прикладных исследованиях, технологических процессах и медицине. Однако достаточно мощные, компактные, способные работать при комнатной температуре и обеспечивающие возможность большой перестройки рабочей частоты усилители и источники электромагнитного поля в этой частотной области до сих пор отсутствуют. В принципе, они могут быть созданы на базе хорошо известных и реализованных экспериментально в различных средах безынверсных трехуровневых схем усиления(см. [1,2] и рис. 1). Теоретические расчеты

7



Рис. 1. Расположение уровней энергии в одном из вариантов трехуровневой схемы безынверсного усиления. ω — частота накачивающего излучения, ω' — частота усиливаемого поля, \hbar — постоянная Планка.

показывают, что в таких схемах при определенных условиях положение максимума коэффициента усиления как функции частоты усиливаемого поля ω' может существенно зависеть от амплитуды E_0 накачивающего поля $\mathbf{E} \equiv [\mathbf{E}_0 \exp(-i\omega t) + \mathbf{E}_0 \exp(i\omega t)]/2$ [3]. Однако для перестройки частоты усиления или генерации в дальнем ИК- и THz-диапазоне путем изменения E_0 необходимо, чтобы частота Раби перехода $2 \leftrightarrow 1$, $|\mathbf{d}_{21}\mathbf{E}_0|/\hbar$ (где \mathbf{d}_{21} — дипольный момент перехода $2 \leftrightarrow 1$) также лежала в этой частотной области. Вследствие этого рализация данного метода в атомарных или молекулярных активных средах, характеризующих-ся малыми дипольными моментами переходов, требует применения весьма высоких интенсивностей накачивающего излучения, которые труднодостижимы экспериментально и могут вызвать разрушение самой активной среды. В отличие от них активные среды, основанные на полупроводниковых наногетероструктурах, в частности на квантовых ямах (КЯ) (т.е. слоях узкозонного полупроводника, заключенных между

слоями широкозонного), имеют в несколько десятков раз большие дипольные моменты переходов и, следовательно, позволяют надеяться на реализацию данного метода при вполне умеренных интенсивностях накачки.

Настоящая работа посвящена расчету параметров активной среды с КЯ для основанного на указанном методе перестраиваемого безынверсного усилителя или генератора электромагнитного излучения дальнего ИК- и THz-диапазона. Конкретно, рассмотрим активную среду, образованную чередованием симметричных КЯ с толщиной 17.52 nm и барьеров с толщиной 10.74 nm. Каждый барьер представляет собой слой Al_{0.45}Ga_{0.55}As, а КЯ состоит из центрального слоя GaAs с толщиной 2.83 nm и двух симметричных боковых слоев Al_{0.19}Ga_{0.81}As с толщиной 7.35 nm каждый. Вследствие свободного движения в плоскости КЯ, уровни энергии электронов в такой структуре зависят от их квазиимпульсов р в плоскости КЯ и формируют подзоны размерного квантования $e_i \equiv e_{i0} + p^2/(2m)$, где e_{i0} — энергия дна подзоны, m эффективная масса для движения электронов в плоскости КЯ. Так как импульсы фотонов малы по сравнению с импульсами электронов, то электромагнитное поле вызывает межподзонные переходы только между состояниями с одинаковыми р. Их частоты, следовательно, равны $\omega_{jk} \equiv (e_j - e_k)/\hbar = (e_{j0} - e_{k0})/\hbar$. Численные расчеты показывают, что для первых трех подзон $e_{10} = 0.094 \text{ eV}, e_{20} = 0.183 \text{ eV}$ и $e_{30} = 0.212 \text{ eV}$ (где энергия отсчитывается от дна зоны проводимости GaAs). Дипольные моменты переходов между этими подзонами направлены вдоль оси роста структуры z. Вследствие того, что подзоны 1 и 3 характеризуются симметричными, а подзона 2 — антисимметричной огибающими волновыми функциями (относительно центральной плоскости КЯ), они отличны от нуля лишь для переходов $2 \leftrightarrow 1$ и $3 \leftrightarrow 2$: $d_{21,32} \equiv e_{2,1,32}$, где e > 0 — элементарный заряд, $z_{21} \approx 2.1$ nm и $z_{32} \approx 5.2$ nm. Вследствие $d_{31} = 0$, а также выполняющегося при указанных выше e_{i0} неравенства $\omega_{32}/\omega_{21} \approx 0.3 \ll 1$, накачка с частотой $\omega \approx \omega_{31}$ будет эффективно взаимодействовать лишь с переходом 2 \leftrightarrow 1, а усиливаемое низкочастотное дальнее ИК- или THz-поле $\mathbf{E}' \equiv [\mathbf{E}'_0 \exp(-i\omega' t) + \mathbf{E}'_0 \exp(i\omega' t)]/2$ лишь с переходом $3 \leftrightarrow 2$.

В результате взаимодействие такой системы с полем накачки и с усиливаемым дальним ИК- или THz-полем описывается следующей системой уравнений для элементов матрицы плотности электронов $\rho_{jk}(t, p) \equiv \rho_{kj}^*(t, p)$ [4] (после введения новых переменных согласно

 $\rho_{31} \equiv \tilde{\rho}_{31} \exp(-i\omega t), \ \rho_{21} \equiv \tilde{\rho}_{21} \exp(-i\omega t)$ и $\rho_{32} \equiv \tilde{\rho}_{32}$ и пренебрежения членами, пропорциональными $\exp(\pm 2i\omega t)$, — обычное приближение "вращающейся волны" для накачки [5]):

$$\dot{\tilde{\rho}}_{21} + \left[i(\omega_{21} - \omega) + 1/t_{21}\right]\tilde{\rho}_{21} = \frac{i\mathbf{d}_{23}\mathbf{E}'}{\hbar}\tilde{\rho}_{31} + \frac{i\mathbf{d}_{21}\mathbf{E}_0}{2\hbar}(\rho_{11} - \rho_{22}), \quad (1)$$

$$\dot{\tilde{\rho}}_{31} + \left[i(\omega_{31} - \omega) + 1/t_{31}\right]\tilde{\rho}_{31} = \frac{i\mathbf{d}_{32}\mathbf{E}'}{\hbar}\tilde{\rho}_{21} - \frac{i\mathbf{d}_{21}\mathbf{E}_0}{2\hbar}\tilde{\rho}_{32},\qquad(2)$$

$$\dot{\tilde{\rho}}_{32} + (i\omega_{32} + 1/t_{32})\tilde{\rho}_{32} = \frac{i\mathbf{d}_{32}\mathbf{E}'}{\hbar}(\rho_{22} - \rho_{33}) - \frac{i\mathbf{d}_{12}\mathbf{E}_0^*}{2\hbar}\tilde{\rho}_{31},\qquad(3)$$

$$\dot{\rho}_{11} = -2\mathrm{Im}\left(\frac{\mathbf{d}_{12}\mathbf{E}_{0}^{*}}{2\hbar}\tilde{\rho}_{21}\right) - \frac{\rho_{11} - \rho_{11e}}{t_{1}} - \frac{\rho_{11}N_{2e}/N_{1e} - \rho_{22}}{T_{21}} - \frac{\rho_{11}N_{3e}/N_{1e} - \rho_{33}}{T_{31}},$$
(4)

$$\dot{\rho}_{22} = -2\mathrm{Im}\left(\frac{\mathbf{d}_{23}\mathbf{E}'}{\hbar}\tilde{\rho}_{32}\right) + 2\mathrm{Im}\left(\frac{\mathbf{d}_{12}\mathbf{E}_{0}^{*}}{2\hbar}\tilde{\rho}_{21}\right) \\ -\frac{\rho_{22}-\rho_{22e}}{t_{2}} - \frac{\rho_{22}-\rho_{11}N_{2e}/N_{1e}}{T_{21}} - \frac{\rho_{22}N_{3e}/N_{2e}-\rho_{33}}{T_{32}}, \quad (5)$$

$$\dot{\rho}_{33} = 2 \operatorname{Im} \left(\frac{\mathbf{d}_{23} \mathbf{E}'}{\hbar} \tilde{\rho}_{32} \right) - \frac{\rho_{33} - \rho_{33e}}{t_3} - \frac{\rho_{33} - \rho_{11} N_{3e} / N_{1e}}{T_{31}} - \frac{\rho_{33} - \rho_{22} N_{3e} / N_{2e}}{T_{32}}.$$
(6)

Здесь t_{31} , t_{21} и t_{32} — феноменологические времена релаксации недиагональных элементов матрицы плотности $\tilde{\rho}_{31}$, $\tilde{\rho}_{21}$ и $\tilde{\rho}_{32}$ к нулю вследствие внутриподзонного электрон-фононного и электронэлектронного рассеяния t_j , j = 1, 2, 3, — феноменологические времена релаксации диагональных элементов ρ_{jj} (т.е. населенностей) к их квазиравновесным значениям ρ_{jje} за счет тех же процессов внутриподзонного электрон-фононного и электрон-электронного рассеяния. Для рассматриваемых параметров структуры и комнатной температуры $t_{31} \approx t_{21} \approx t_{32} \approx t_j \sim 0.1$ рs. Величины ρ_{jje} даются распределениями

$$N_j \equiv 2\pi \int\limits_0^{+\infty}
ho_{jj} p dp / (2\pi\hbar)^2$$

(верхний предел интегрирования взят равным бесконечности вследствие быстрого убывания подынтегральной функции при больших p). Величины T_{21} , T_{31} и T_{32} — феноменологические времена межподзонной релаксации, которые для рассматриваемых параметров примерно равны 1 рs. Величины N_{je} — равновесные (т.е. имеющиеся в отсутствие полей) поверхностные концентрации электронов в подзонах, определяемые полной поверхностной концентрацией $N \equiv 2(N_1 + N_2 + N_3) \equiv 2(N_{1e} + N_{2e} + N_{3e})$, где фактор 2 учитывает двукратную вырожденность подзон по проекциям спина. Анализ показывает, что оптимальное для усиления дальнего ИК- или THz-поля значение $N = 2 \cdot 10^{12}$ сm⁻². Оно может быть достигнуто путем n^{++} допирования КЯ.

Для определения N_j положим $\mathbf{E}' = 0$ и найдем стационарное решение (1)–(6). Затем умножим любые два из уравнений (4)–(6) на $2\pi p d p/(2\pi\hbar)^2$ и проинтегрируем по p от 0 до $+\infty$ с учетом того, что

$$2\pi \int_{0}^{+\infty} \rho_{jj} p dp / (2\pi\hbar)^2 \equiv 2\pi \int_{0}^{+\infty} \rho_{jje} p dp / (2\pi\hbar)^2.$$

В результате получим систему двух уравнений для N_1 , N_2 , в которой $N_3 \equiv N/2 - N_1 - N_2$. Ее численное решение показывает, что при интенсивности накачки $I \equiv nc |\mathbf{E}_0|^2/(8\pi) = 3 \cdot 10^{11} \text{ W/m}^2$ (где c — скорость света в вакууме, $n \approx 3.3$ — характерное значение показателя преломления AlGaAs в среднем ИК-диапазоне, где лежит частота накачки ω) $N_1 \approx 5.88 \cdot 10^{15} \text{ m}^{-2}$, $N_2 \approx 3.38 \cdot 10^{15} \text{ m}^{-2}$ и $N_3 \approx 7.4 \cdot 10^{14} \text{ m}^{-2}$. Таким образом, накачка заселяет вторую подзону, делая N_2 сравнимой с N_1 , несмотря на то что $N_{2e} \ll N_{1e}$. При этом N_3 , как и в равновесном случае, остается много меньшей, чем N_1 и N_2 . При большей $I = 9.5 \cdot 10^{11} \text{ W/m}^2 N_1 \approx 5.33 \cdot 10^{15} \text{ m}^{-2}$, $N_2 \approx 3.86 \cdot 10^{15} \text{ m}^{-2}$ и $N_3 \approx 8.1 \cdot 10^{14} \text{ m}^{-2}$.



Рис. 2. Коэффициент усиления дальнего ИК- и THz-поля по интенсивности как функция его частоты ν' при $I = 3 \cdot 10^{11} \text{ W/m}^2$ (сплошная кривая) и $I = 9.5 \cdot 10^{11} \text{ W/m}^2$ (штриховая кривая).

Для определения коэффициента усиления дальнего ИК- или THz-поля g необходимо найти линейное по E' решение системы (1)–(6) и на его основе вычислить диэлектрическую проницаемость рассматриваемой системы ε на частоте ω' . Далее, из дисперсионного уравнения для поперечной волны дальнего ИК- или THz-поля, $k'^2 = \omega'^2 \varepsilon/c^2$, где k' — ее волновое число, определяется $g \equiv -2 \text{Im}k'$. Величина g имеет максимум примерно при

$$\omega_m' = \frac{1}{2} \left[\omega - \omega_{31} - \omega_{32} + \sqrt{(\omega - \omega_{31} + \omega_{32})^2 + \frac{|\mathbf{d}_{21}\mathbf{E}_0|^2}{\hbar^2}} \right].$$
(7)

Из (7) следует, что наибольший диапазон изменения ω'_m с вариацией \mathbf{E}_0 достигается при $\omega = \omega_{31}$, т.е. когда частота накачки равна частоте дипольно запрещенного перехода $3 \leftrightarrow 1$. Зависимоть g от частоты $\nu' \equiv \omega'/(2\pi)$ дальнего ИК- или THz-поля показана на рис. 2. Из него видно, что для $I = 3 \cdot 10^{11}$ W/m² максимум g лежит примерно при 1 THz, а для $I = 9.5 \cdot 10^{11}$ W/m² при 2 THz, т.е. его положение меняется в 2 раза. При этом в обоих случаях, согласно сказанному выше, $N_3 < N_2 < N_1$, т.е. инверсия между подзонами отсутствует и усиление дальнего ИК- и THz-поля обусловливается безынверсным механизмом.



Рис. 3. Схема перестраиваемого безынверсного лазера. Активная среда (последовательность КЯ и барьеров) нанесена на верхнюю грань призмы из GaAs.

В качестве источника накачки может использоваться, например, CO_2 -лазер, генерирующий на длине волны $10.6\,\mu$ m (соответствующей частоте перехода $3 \leftrightarrow 1$) и работающий в импульсном режиме (чтобы избежать разрушения структуры). Для предотвращения омического поглощения дальнего ИК- или THz-поля на электронах необходимо, чтобы в активной области оно было поляризовано вдоль оси z. Этого можно добиться в геометрии, когда луч дальнего ИК- или THz-поля падает на активную среду под критическим углом полного внутреннего отражения, а \mathbf{E}' лежит в плоскости падения [2] (рис. 3). При этом отражения на боковых гранях призмы устраняются путем выбора их наклонов таким образом, чтобы луч дальнего ИК- или THz-поля падал на них под углами Брюстера, а внешний резонатор образуется металлическими зеркалами, имеющими в дальнем ИК- и THz-диапазоне коэффициент отражения > 99%.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 07-02-00486-а, 08-02-00163-а, 09-02-97043-р_поволжье).

Список литературы

- Kocharovskaya O., Mandel P., Radeonychev Y.V. // Phys. Rev. A. 1992. V. 45. P. 1997–2005.
- [2] Frogley M.D., Dynes J.F., Beck M., Faist J., Phillips C.C. // Nature Materials. 2006. V. 5. P. 175–178.
- [3] Kocharovskaya O., Radeonychev Y.V., Mandel P., Scully M.O. // Phys. Rev. A. 1999. V. 60. P. 3091–3110.
- [4] Ханин Я.И. Основы динамики лазеров. М.: Наука, 1999. Гл. 2.
- [5] Аллен Л., Эберли Дж. Оптический резонанс и двухуровневые атомы. М.: Мир, 1978. Гл. 2. (Allen L., Eberly J.H. Optical Resonance and Two-Level Atoms. New York: John Wiley & Sons, 1975. Ch. 2).